

請求の範囲

1. 下記 (a) 成分及び (b) 成分を含有することを特徴とするガス発生剤組成物。

(a) 燃料であるポリオキシメチレン重合体又はポリオキシメチレン共重合体

(b) 窒素を含まない酸化剤

2. 更に下記 (c) 成分及び (d) 成分からなる群から選ばれる 1 又は 2 以上を含有する請求項 1 記載のガス発生剤組成物。

(c) 窒素を含まないバインダ

(d) 金属酸化物、金属水酸化物、金属炭酸化物から選ばれる添加剤

3. (a) 成分の含有量が 5 ～ 35 質量%、(b) 成分の含有量が 95 ～ 65 質量%である請求項 1 記載のガス発生剤組成物。

4. (a) 成分の含有量が 5 ～ 35 質量%、(b) 成分の含有量が 95 ～ 65 質量%、(c) 成分の含有量が 0 ～ 15 質量%、(d) 成分の含有量が 20 質量%以下である請求項 2 記載のガス発生剤組成物。

5. (a) 成分の燃料が、パラホルムアルデヒド又はポリアセタール樹脂である請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載のガス発生剤組成物。

6. (b) 成分の酸化剤が、酸化銅である請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載のガス発生剤組成物。

7. (c) 成分のバインダが、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩、カルボキシメチルセルロースカリウム塩、酢酸セルロース、セルロースアセテートブチレート、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルエチルセルロース、微結晶性セルロース、ポリビニルアルコール、アクリルゴム、グアガム、デンプン、シリコーンから選ばれる 1 又は 2 以上である請求項 2 ～ 6 のいずれか一項に記載のガス発生

剤組成物。

8. (d) 成分の添加剤が、酸化第二銅、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化コバルト、酸化マンガン、酸化モリブデン、酸化ニッケル、酸化ビスマス、シリカ、アルミナを含む金属酸化物、水酸化アルミニウム、水酸化コバルト、水酸化鉄を含む金属水酸化物；炭酸コバルト、炭酸カルシウム、塩基性炭酸亜鉛、塩基性炭酸銅を含む金属炭酸塩又は塩基性金属炭酸塩；酸性白土、カオリン、タルク、ベントナイト、ケイソウ土、ヒドロタルサイトを含有する金属酸化物又は水酸化物の複合化合物；ケイ酸ナトリウム、マイカモリブデン酸塩、モリブデン酸コバルト、モリブデン酸アンモニウム等の金属酸塩；シリコーン、二硫化モリブデン、ステアリン酸カルシウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素から選ばれる1又は2以上である請求項2～7の記載のガス発生剤組成物。

9. (a) 成分としてパラホルムアルデヒド又はポリアセタール樹脂、(b) 成分として酸化銅を含有する請求項1記載のガス発生剤組成物。

10. (a) 成分として5～35質量%のパラホルムアルデヒド、(b) 成分として95～65質量%の酸化銅を含有する請求項1記載のガス発生剤組成物。

11. (a) 成分として5～35質量%のポリアセタール樹脂、(b) 成分として95～65質量%の酸化銅を含有する請求項1記載のガス発生剤組成物。

12. (a) 成分としてパラホルムアルデヒド又はポリアセタール樹脂、(b) 成分として酸化銅、(c) 成分としてカルボキシメチルセルロースナトリウム塩又はグアガムを含有する請求項2記載のガス発生剤組成物

13. (a) 成分として15～25質量%のパラホルムアルデヒド、(b) 成分として65～90質量%の酸化銅、(c) 成分として0.1～10質量%のカルボキシメチルセルロースナトリウム塩又はグアガムを含有する請求項2記載のガス発生剤組成物。

14. (a) 成分として15～25質量%のポリアセタール樹脂、(b) 成分として65～90質量%の酸化銅、(c) 成分として0.1～10質量%のカルボキ

シメチルセルロースナトリウム塩又はグアガムを含有する請求項2記載のガス発生剤組成物。

15. (a)成分として10～25質量%のパラホルムアルデヒド、(b)成分として65～90質量%の酸化銅、(c)成分として0.1～10質量%のカルボキシメチルセルロースナトリウム塩、(d)成分として1～15質量%の水酸化アルミニウム又は1～10質量%の酸化コバルトを含有する請求項2記載のガス発生剤組成物。

16. (a)成分として10～25質量%のポリアセタール樹脂、(b)成分として65～90質量%の酸化銅、(c)成分として0.1～10質量%のカルボキシメチルセルロースナトリウム塩、(d)成分として1～15質量%の水酸化アルミニウム又は1～10質量%の酸化コバルトを含有する請求項2記載のガス発生剤組成物。

17. 請求項1～16のいずれか一項に記載のガス発生剤組成物を押出し成型して得られる、単孔円柱状又は多孔円柱状のガス発生剤組成物成型体。

18. 請求項1～16のいずれか一項に記載のガス発生剤組成物を圧縮成型して得られる、ペレット形状のガス発生剤組成物成型体。

19. 請求項1～16のいずれか一項に記載のガス発生剤組成物、又は請求項17又は18記載のガス発生剤成型体を用いるエアバッグ用インフレーター。